后向散射激光多普勒测速装置

孙 渝 生

(上海市激光技术研究所)

提 要

本文描述一台后向散射激光多普勒测速装置及其设计思想。这一装置已成功地 在实验室运转,它由一台 20 毫瓦单模运转的 He-Ne 激光器、一个发送和接收的光学 头部和一台信号处理机组成。现在,已接收到了 580 毫米距离的后向多普勒信号。

这里所介绍的是一台差分式后向散射激 光多普勒测速装置及其设计思想。差分式激 光多普勒速度计的光路如图1所示。根据激 光发送装置和光电接收器的位置,又可分为 前向接收方式(图1(a))和后向接收方式(图 1(b))。





我们的实验装置由激光源、激光发送系统、接收装置以及信号处理机组成。由于采用了如图1(b)所示的光路结构,将激光发送系统与接收装置合并在同一个单元之中,整个实验装置的设计要求是以后向接收方式测

量水流或其它流体、固体的运动速度,目前后 向测量距离为580毫米,测速范围: 0.5~25 米/秒,仪器精度:1~2%,测量方向:一维。 下面分别描述这一装置的三个组成部分。

1. 激光光源

我们知道,瑞利散射光的强度与波数的 四次方成比例,波长愈短,散射光愈强。但是, 多普勒频率不确定性随波数也同等程度地增 加。一般来讲,波长短些较好。但是由于多 普勒频率与波长成反比,所以在速度较高时, 多普勒频率也较高,这样对信号处理装置的 要求也相应提高。在这里,我们选择了工作 稳定可靠的 6328 埃横向单模氮--氖激光器。

由于后向散射光很微弱,因此希望激光 管的输出功率尽可能地高,以得到尽可能强 的后向散射信号。要提高激光器的输出功率, 就必须增加激光管的长度,但这样一来,就可 能出现更多彼此之间频率更加靠近的轴向模 振荡。对于任一腔长为 L 的激光器,其轴向 模之间的频率间隔可以依照下列关系来计 算:

$$\Delta f_M = \frac{c}{2L} \tag{1}$$

式中: c 为光速。

收稿日期: 1978年11月15日。

如果激光器运转在阈值附近,那末有效 增益曲线的带宽 *4f*_a 是不知道的,因此不能 计算激发模的数目,而只能从激光器的技术 指标得知。然而为了得到高输出的激光功率, 多数激光器都将很好地工作在阈值之上,这 就使有效增益曲线的线宽趋近于活性介质的 原子跃迁的线宽,从参考文献[1]可以得到在 0.6328 微米的 Ne 多普勒线宽 *4f*_D=1700 兆赫。这样,从下列关系式就可以算出轴模 数目:

$$m = \frac{\Delta f_D}{\Delta f_M} \approx \frac{\Delta f_D \cdot 2L}{c} \tag{2}$$

在考虑激光光源时,应该选择激光器的 腔长,使其产生的纵模间隔大大地高于被测 的多普勒频率。在一旦选定了多轴模激光器 的同时,还应考虑到其轴模对激光辐射时间 相干性的影响,从而对光束分裂器的设计提 出要求,在本装置中采用了输出功率为 20 毫 瓦以上的外腔式氦-氖激光器,腔长约1.2 米,轴模间隔为 125 兆赫。

2. 光学头部

这里,采用了如图1(b)所示的光学结 构。由前节已知,对于同一激活介质,增加腔 长,将有较高的激光输出功率,但也使激发轴 向模的数量增加, 而轴向模较多的激光器只 有当二束入射光处于零光程的条件下,才能 充分发挥其成效。如果二束光存在有限的光 程差,在多轴模的情况下,多普勒信号的幅度 将由于光程差的存在而衰减。因此,在设计 分束器时,应当考虑到使其二束光到达测量 区的程差尽量相等,以避免由于轴模数的增 加而引起的信号衰减。本装置采用如图2所 示的柯斯特棱镜进行分光以达到这一目的。 棱镜的设计和加工应保证分出来的二束光相 互平行,强度相等。某些理论研究指出[2].差 分式激光多普勒速度计的信噪比将随入射到 测量区二束光之间的相对偏移而指数地下 降,这一关系指出:差分式激光多普勒速度计 的信噪比对二束入射光的不平行度和发送系



图 2 柯斯特棱镜分束器

统的聚焦性能是非常敏感的。在同一篇文章 中又指出:当二束光的强度比为0.4:1时,其 信噪比将减少到二束光强度相等时的一半。 所以这对柯斯特棱镜分束器半透膜的分束性 能提出了要求。这里,二束光的强度比高于 0.7:1。

由于设计这一装置的目的是为了测量具 有一定截面的流体速度分布,所以选取聚焦 透镜1的焦距较长,为580毫米。为了收集 到较多的后向散射光,透镜1和2的有效通 光孔径也设计得较大。整个光学结构尺寸的 设计使得1米/秒的速度相当于200千赫的 多普勒频率。

光学头部中的另一重要部分是光电接收器。 从图 1(b) 可见由二束入射光相交的测量区散射出来的后向散射光由透镜1收集,并变为平行光,再由全反射镜1反射,通过透镜2会聚,并经由反射镜2的反射到达光电接收器。

在可见光区域,能用于测速仪的光电探 测器有三种^[3]:光电倍增管、硅光二极管和雪 崩管。光电倍增管具有很低的暗电流,其主 要特色是噪声很低,增益很高;光电二极管虽 然有很高的量子效率,但是其暗电流较大;雪 崩管与普通的光电二极管具有几乎同样的特 性,放大倍数较高。在 30 兆赫的信号带宽之 内,这三种探测器的信噪比与入射光功率的 关系示于图 3。如果带宽低于 100 兆赫,在入 射光功率很低的情况下(约 10⁻⁷ 瓦以下),光 电倍增管是较为理想的接收器件;但在入射 光功率 较高 的情况下(10⁻⁷~10⁻⁵ 瓦),雪

· 35 ·



图 3 信噪比随入射光功率的变化 *A*. 光电二极管; *B*. 雪崩二极管; *C*. 光电倍增管

崩管的信噪比就比较高了。在更强的入射光 功率下(>10⁻⁵ 瓦),则要数光电二极管为最 佳了。一般对于前向散射的光学系统,其散 射信号功率较强,可以选用光电二极管。本 装置中,由于接收较远距离的后向散射信号, 而在较小角度的(小于10°)接收范围内,后 向散射信号的强度比前向散射信号的强度低 几百倍,所以光功率很弱,因此采用光电倍增 管作为接收元件。

为了使由于测量区的微粒子所产生的多 普勒电流信号最大,使噪声尽可能小,光电倍 增管前的光阑孔径应该等于二束光相交所组 成的测量区在光阑平面上所成的象。光阑太 小将使有效的信号降低;而光阑太大,则将引 入不必要的噪声。在本装置中,为了进一步 滤去进入光阑的背景杂散光,在光电接收器 前面加了一块 6328 埃的干涉滤光片。

所有的光学元件和接收元件都安装在一 个牢固的头部之中(见图 6),它们能够微调, 但一经调好,就被牢固地锁定,使它们之间的 相对位置保持不变。

3. 信号处理装置

由光电倍增管接收到的多普勒频移必需 被准确地测量并记录下来,或者直接按速度 的形式用数字显示。为了达到这一目的所发 展起来的信号处理装置有频谱分析仪、频率 跟踪器、计数型处理机等。在本装置中,采用 频率跟踪器作为信号处理装置,它把多普勒 信号从各种各样的噪声中检测出来,并经过 变换以速度的形式显示。频率跟踪器的优点 就是能够用于信噪比较低的情况,并能在较 大范围内对变化的速度进行跟踪,亦便于实 时显示。

频率跟踪器的方框图如图4所示,这是 一个自动频率跟踪的反馈环,其原理简述如 下:从光电倍增管收到的多普勒信号 fp 首先 送入前置放大器,为了提高信噪比,设计前置 放大器使其通带等于被测流体的多普勒频率 的范围,以尽可能去除不必要的噪声。放大 后的信号进入混频器, 混频器的另一输入信 号来自一个机内的压控振荡器,其频率用 fvco 表达。 混频器的输出将含有频率成分 $f_{vco} - f_p$ 和 $f_{vco} + f_p$ 。应当这样地设计环路, 使得当 fvco-fp 等于第一中频放大器谐振 中心频率 fir 或处于其附近值时,环路处于 锁定状态。这时第一中放输出信号的频率 fvco-fD 近似等于 fir,这一输出信号进入 限幅器 I,由限幅器 I 输出频率相同、空度比 为1的方波信号,又进入第二中频放大器。这 是一个串联谐振的中频放大器,其谐振中心 频率也是fir, 它的输出信号与输入信号同 频率,但有一相移,由第二中放输出的信号又 进入第二限幅器,从第二限幅器也得到一个 方波。它的频率与第一限幅器的输出方波相 同,但是二个方波信号有一个相位差,第二限 幅器方波输出的空度比也为1。





现在分析一下二个限幅器输出方波的位 相关系及其在回路中所起的作用。先看一看 第二中频放大器的特性(图5),因为它是一 个串联谐振电路,所以当输入信号频率等于 它的谐振频率时,增益最高。此时输出频率 不仅与输入相同,而且其位相比输入信号滞 后 - 3; 当输入信号频率高于回路谐振频率 时,输出信号滞后的位相将大于 $\frac{\pi}{2}$;而当输 入频率低于回路谐振频率时, 输出信号滞后 的位相将小于一次。而第二限幅器输出的方 波位相也同样随之变化。现在把第一限幅器 和第二限幅器的二个输出方波送到鉴相器中 去进行比较。那末第一限幅器、第二中放、第 二限幅器和鉴相器就组成了一个鉴频器。这 个鉴频器的功能如下: 当限幅器 I 输入信号 的频率正好等于中频频率 frr 时, 鉴相器对 二个方波进行比较的结果是在积分电路上产 生一个平均值为零的直流电压; 当输入频率 低于中频 fir 时, 整个鉴频器也就是鉴相器 输出平均值为正的直流电压; 而当输入频率 高于中频 fir 时, 整个鉴频器也就是鉴相器 输出平均值为负的直流电压。



图 ³ 第一甲频放大器的 辐频特性及相频特性

把鉴频器在积分电路上平均的直流电压 送至直流放大器进行放大,并通过直流放大 器进行电平变换。将其输出去控制那个压控 振荡器,使压控振荡器的输出频率与这一 控制电压成较好的线性关系(线性度优于 1~2%),再把压控振荡器的输出馈入混频 器。至此,整个频率自动反馈控制系统的跟 踪回路就构成了。

在整个回路对变化的多普勒频率进行跟 踪时,回路的工作状态如下:当输入频率fp 有一变化时,回路的功能将迫使压控振荡器 的输出频率也相应地变化, 使 fvco 始终近似 地比输入的多普勒频率 fp 高一个中频频率 f_{IF} 。如果 f_D 增加,则必然使混频器的 输出 $f_{vco}-f_{D}$ 有一下降趋势。这时鉴频器的输 入频率也下降,从而使它输出一个比原来状 态高的直流电压,经直流放大器放大后,迫使 压控振荡器输出 f_{vco} 上升, 使它 与 f_p 仍 然 相差一个接近于 fir 的频率。相反,如果 fp 下降,则经过回路的反馈作用,必定迫使fvco 下降, 使它与fp之差保持一个接近于fir的 频率。这样 free 或者与其成线性关系的直 流电压就能用来代表多普勒频率或者流体的 速度了。

这里必需注意的是: fvco 与f_D之差,除 了在回路的一个工作点之外,并非是一个严 格的固定不变的中频 f_{IF}, 而是有一个小的 误差。正是由于有了这一小的误差,所以才 有一个鉴频器的直流输出来控制压控振荡器 的输出频率,使其跟随 f_D的变化。所以说, 这是一个有差系统。在设计这一系统时,必 需注意到,不能使这一误差超过仪器所规定 的数值。回路闭环增益越高,系统误差越小, 但闭环增益太高将使整个回路不稳定。

总之,频率跟踪器的整个闭环回路,使得 带有噪声的多普勒信号得到"澄清",把不连 续的由流体中微粒子产生的信息变换成连续 而清晰的振荡波形,而且具有跟随其变化的 能力,所以也称其为跟踪滤波器。

最后,把压控振荡器输出的频率信号送 入一个数字显示单元,再用数字的形式直接 将速度显示出来。压控振荡器的输入电压直 接代表多普勒频率和速度,而流体中速度的 波动,也将由这一模拟电压所反映出来。

以上对后向散射的激光多普勒测速装置 的三个主要部分作了叙述,整个装置的外型 见图 6。目前已在实验室用它对一个小水筒 模型中的水流进行了速度测量。水筒的测量 段是一根内径为 ϕ 35 毫米的玻璃管,其一侧 被磨去而镶上一块平的普通窗玻璃,由头部 射出的二束激光束通过这一窗口聚焦在玻璃 管中部。小水筒是一个闭合的水流循环装置, 其流动由一个用三相调压器 控制的水泵 带 动,调节三相调压器的电压,就能调节水流的 流速,其速度从较低的值开始,达6米/秒左 右为最高。水筒中的循环水用一般自来水。 对于后向散射,可适当加入极少量的微粒子, 直径在几个微米左右为好,浓度约 10⁻⁵ 的量 级左右。



图 6 后向散射激光多普勒测速装置

现在已用频率跟踪器对于 0.5 米/秒至 6 米/秒左右的水流速度产生的 多 普勒频率 进行了跟踪,当被测流速变化时,跟踪器的输 出频率亦能很快地跟随流速的变化,跟踪器 前置放大器输出的多普勒信号波形以及跟踪 滤波器输出的压控振荡器波形示于 图 7,可 图 7 上图: 多普勒信号波形 下图: 压控振荡输出波形

见整个激光多普勒测速实验装置在这一工作 条件下已能满意地运转。

小结

激光测速仪原理简单,能用来测定各种 各样的流体速度,而且具有许多其它仪器不 可能具备的特点,特别是用热线风速仪或毕 托管难以测定的场合,如紊流、高温流、附面 层等,用这一方法就更能显出其优点。因此, 作为实用的装置,其发展前景非常广阔,其发 展速度也必然是令人注目的了。

参考文献

- [1] A. I. Bloom; Proc. IEEE, 1966, 54, No. 10, 1262.
- [2] H. Mishina et al.; Opto-electronics, 1973, 5, No. 6, 517.
- [3] L. Lading; Opto-electronics, 1973, 5, No. 2, 175.

* ๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛ *

(上接第40页)

实际毛坯不一定是等径生长的。 熔体中的 Nd⁸⁺ 分布也不一定均匀。 熔体对流或者非 准静态生长都会导致实际分布与理论公式的 偏离。 图 3 中, 有些晶体显然偏离了幂指数 关系。这说明实际测量是很有必要的。

EC-126 原料中掺有 0.1% 的碳, 在 110 毫米长的毛坯中, Nd³⁺ 浓度保持高水平, 原 因不太清楚。

有关 Nd³⁺ 浓度对激光性能影响的问题, 可参阅文献[3]和[4]。

速度快、方法简单,是这种测定的优点。 • 38 • 所得结果的精度~±10%;所以,分光光度法 测定 YAG:Nd³⁺的浓度,已经被广泛地采用。 在解释 YAG 棒的性能、研究毛坯浓度均匀 化和发光浓度猝灭时,在计算某些光谱特性 时,都使用了这种测量方法和测定结果。

参考文献

- [1] T. Kushida et al.; Phys. Rev., 1968, 167, 289.
- [2] 《晶体生长的理论基础》(讲义),南京大学物理教研 室,1976年,第2、8页。
- [3] D. A. Pinow; IEEE J. Quant. Electr., 1970, QE-6, No. 4, 223.
- [4] R. F. Bert; Laser Focus, 1973, 9, No. 8, 51.
- [5] R. R. Monchamp; J. Cryst. Growth, 1971, 11, 310.